

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2004年12月29日 (29.12.2004)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2004/113071 A1

- (51)国際特許分類: B32B 27/28, 27/34 (81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21)国際出願番号: PCT/JP2004/008833
- (22)国際出願日: 2004年6月17日 (17.06.2004)
- (25)国際出願の言語: 日本語
- (26)国際公開の言語: 日本語
- (30)優先権データ:
特願2003-174044 2003年6月18日 (18.06.2003) JP
- (71)出願人(米国を除く全ての指定国について): グンゼ株式会社 (GUNZE LIMITED) [JP/JP]; 〒6238511 京都府綾部市青野町膳所1番地 Kyoto (JP).
- (72)発明者; および
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 丹羽治 (NIWA, Osamu) [JP/JP]; 〒9691104 福島県安達郡本宮町大字荒井字恵向88 福島プラスチックス株式会社内 Fukushima (JP). 豊永 武彦 (TOYONAGA, Takehiko) [JP/JP]; 〒5240064 滋賀県守山市森川原町163 グンゼ株式会社内 Shiga (JP).
- (74)代理人: 三枝 英二, 外 (SAEGUSA, Eiji et al.); 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 北浜TNKビル Osaka (JP).

- (84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

WO 2004/113071 A1

(54) Title: POLYAMIDE MULTILAYER FILM

(54)発明の名称: ポリアミド系多層フィルム

(57) Abstract: A polyamide multilayer film is disclosed which comprises at least one layer of each of saponified ethylene-vinyl acetate copolymer and polyamide. The polyamide multilayer film is excellent in boiling resistance and retort properties. Also disclosed is a method for producing such a polyamide multilayer film.

(57)要約: 本発明は、エチレン-酢酸ビニル共重合体けん化物層とポリアミド層とをそれぞれ少なくとも1層ずつ含むポリアミド系多層フィルムであり、耐ボイル・レトルト性に優れたポリアミド系多層フィルム、及びその製法を提供する。